

ЭЛЕКТРОПОЛЕВОЙ ЭФФЕКТ В ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$

А.С. П о р т н я г и н, В.С. К о р т о в,
И.И. М и л ь м а н, М.С. А к с е л ь р о д

В настоящее время проявляется значительный интерес к разработке лазерных и дозиметрических материалов на основе центров окраски в монокристаллическом лейкосапфире [1, 2]. В этой связи актуальным представляется изучение люминесцентных свойств этих материалов при одновременном воздействии физических полей различной природы [3].

В работе изучено влияние внешнего электрического поля на рентгенолюминесценцию и термовысвечивание $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$, выращенного в сильновосстановительных условиях. Образцы размером $10 \times 10 \text{ mm}^2$ и толщиной от 0.06 до 1.0 мм по данным измерения спектров оптического поглощения содержали $10^{16}\text{-}10^{17} \text{ см}^{-3}$ анионных вакансий (F -центров). Для возбуждения люминесценции применялось рентгеновское излучение (50 кВ, Со-анод), мощность экспозиционной дозы на образце варьировалась от $2.5 \cdot 10^{-5}$ до $5 \cdot 10^{-2} \text{ Кл} \cdot \text{кг}^{-1}$. Для подачи электрического поля на грани образцов напылялись контакты из алюминия. Часть измерений проводилась с накладными электродами из фольги, отделенными от кристалла тонкой тефлоновой пленкой. При этом тип электродов на полученные результаты влияния не оказывал. Напряженность электрического поля между обкладками варьировалась от 10^3 до $4 \cdot 10^5 \text{ В см}^{-1}$.

Кинетика рентгенолюминесценции в электрическом поле

В спектре стационарной РЛ образцов преобладает широкая бесструктурная полоса свечения с максимумом при 3.0 эВ, обусловленная излучательными переходами в F -центрах [4]. Поэтому ниже будут рассматриваться закономерности свечения только в этой полосе.

При подаче импульса электрического поля на кристалл наблюдается всплеск РЛ, кинетика изменения которой представлена на рис. 1. В момент подачи поля напряженностью $4 \cdot 10^5 \text{ В} \cdot \text{см}^{-1}$ интенсивность свечения возрастает в 2.4 раза. По окончании переходного процесса устанавливается значение, на 30% превышающее интенсивность РЛ в отсутствие поля I_0 . При выключении поля свечение снова скачкообразно усиливается до величины $2.1 \cdot I_0$. Переходные процессы при включении и выключении поля протекают по экспоненциальному закону с одинаковой постоянной времени, обратнопропорциональной мощности дозы. Эффект усиления РЛ пропорционален напряженности поля, начиная с порогового значения $(7\text{-}8) \cdot 10^3 \text{ В} \cdot \text{см}^{-1}$. Кинетика отклика РЛ на импульс электрического поля не зависит от температуры в диапазоне 80–380 К. При более высоких температурах влияние поля исчезает. Смена направления электрического

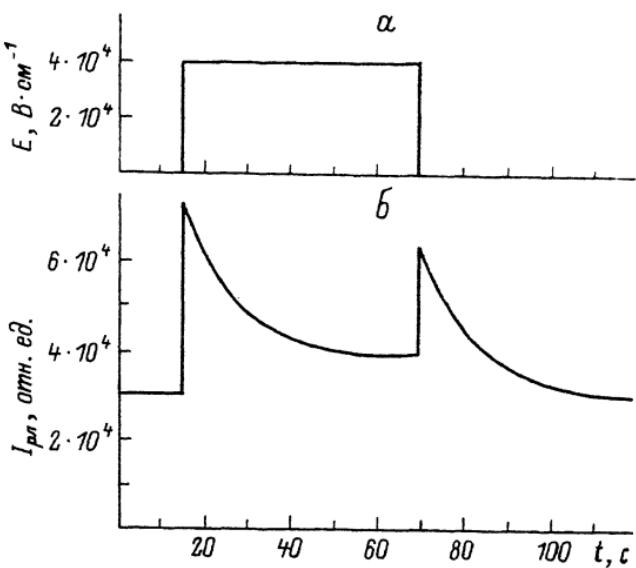


Рис. 1. Временные диаграммы внешнего электрического поля (а) и рентгенолюминесценции монокристаллов $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ (б).

поля на противоположное не приводит к изменению кинетики люминесценции.

Наблюдаемый эффект не связан с электролюминесценцией, т.к. приложение поля без рентгеновского возбуждения свечение кристаллов не вызывает. Не обусловлен он и свечением микропробоев между обкладками, поскольку усиление полем выхода люминесценции наблюдается только в полосе 3.0 эВ.

Захват носителей на ловушки в электрическом поле

С целью изучения захвата носителей на ловушки образцы облучались фиксированной дозой рентгеновского излучения при температуре жидкого азота. Одновременно измерялась светосумма рентгенолюминесценции. Затем в режиме линейного нагрева со скоростью $0.1 \text{ K}\cdot\text{s}^{-1}$ измерялись светосуммы, высвечиваемые в пиках термостимулированной люминесценции (ТСЛ) при 220, 310 и 430 К. Серия циклов облучение-высвечивание показала высокую воспроизводимость результатов (нестабильность измеряемых светосумм не превышала 2%).

В следующей серии измерений к образцу во время облучения прикладывалось импульсное электрическое поле напряженностью $4 \times 10^4 \text{ V}\cdot\text{cm}^{-1}$ с периодом, в два раза превышающим длительность импульса, и на порядок меньшим постоянной времени переходного процесса. Термовысвечивание регистрировалось в отсутствие поля при той же скорости нагрева. По сравнению с результатами, полу-

ченными без поля, наблюдалось синхронное увеличение в 1,3³ раза светосуммы РЛ и светосумм, запасаемых в термoluminesцентных пиках 220, 310 и 430 К. Включение и выключение электрического поля в отсутствие рентгеновского возбуждения не приводит к захвату носителей на ловушки.

Влияние электрического поля на термовысвечивание

Для изучения влияния поля на термовысвечивание в процессе линейного нагрева через каждые 5 К на обкладки предварительно облученных образцов подавались импульсы высокого напряжения (длительность импульсов соответствовала изменению температуры на 2,5 К, напряженность поля между обкладками составляла 4·10⁴ В·см⁻¹). На термовысвечивание в пиках 220 и 430 К электрическое поле влияние не оказывает. В пике 310 К наблюдаются вспышки люминесценции, соответствующие приложению поля (рис. 2). При выключении поля интенсивность ТСЛ падает ниже того уровня, который должен быть без наложения поля. Светосумма ТСЛ, высвечиваемая в этом пике, одинакова как для случая отсутствия электрического поля в процессе нагрева, так и для описанного выше случая нагрева с наложением импульсов поля. Значение светосуммы не изменяется при нагреве образца с постоянно включенным полем.

После облучения образцов при комнатной температуре наблюдается фосфоресценция в F-полосе, затухающая по экспоненциальному закону. Подача электрического поля оказывает на нее такое же влияние, как на термовысвечивание в пике 310 К.

Обсуждение результатов

Переходные процессы, наблюдаемые в РЛ при включении и выключении электрического поля, могут быть связаны с компенсацией внешнего электрического поля внутренним, возникающим в результате направленного дрейфа свободных носителей, их захвата на ловушки и образования объемного заряда.

Обнаруженный электрополевой эффект синхронного усиления выхода рентгенолюминесценции и светосумм, высвечиваемых в термoluminesцентных пиках 220, 310 и 430 К, может быть вызван повышением в поле концентрации пар свободных носителей, создаваемых рентгеновским излучением. В [5] сообщается о возможности понижения в Al_2O_3 средней энергии генерации электронно-дырочной пары в 3–4 раза электрическим полем с напряженностью более 10⁵ В·см⁻¹. Описанные экспериментальные данные находятся в соответствии с этой оценкой. В такой интерпретации факт синхронного усиления полем процессов рекомбинации носителей на F-центрах и захвата носителей на ловушки различной природы легко объясним.

Влияние поля на процесс термовысвечивания в пике 310 К по всей вероятности определяется эффектом Пула–Френкеля.

Проведенное исследование свидетельствует о том, что при рентгеновском возбуждении монокристаллов сильноисстановленного

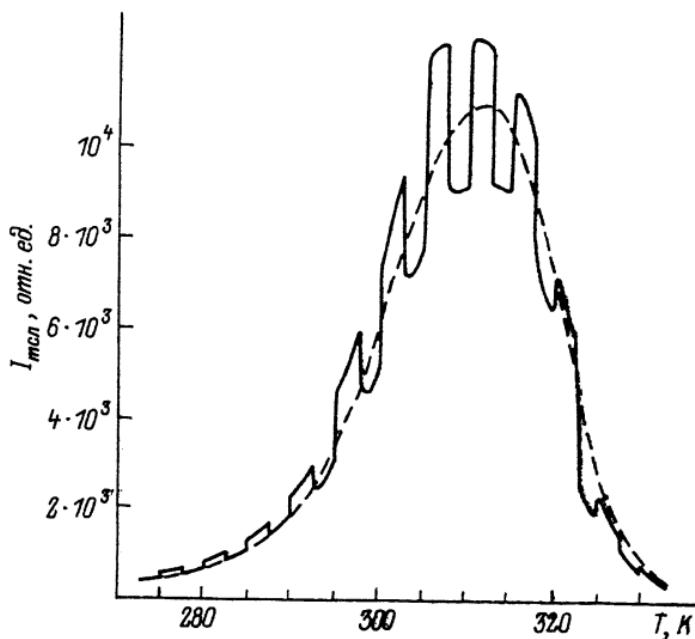


Рис. 2. ТСЛ в пике 310 К монокристаллов α - Al_2O_3 при наложении импульсов электрического поля. Пунктиром: термовысвечивание в отсутствие поля.

α - Al_2O_3 электрополевой эффект наблюдается в основном на этапе генерации носителей, а при термической стимуляции – на этапе делокализации носителей с кулоновских центров захвата.

Л и т е р а т у р а

- [1] Мартынович Е.Ф., Барышников В.И., Григоров В.А. – Письма в ЖТФ, 1985, т. 11, в. 4, с. 200–202.
- [2] Аксельрод М.С., Мильман И.И. – Изв. АН СССР. Сер. физ., 1982, т. 46, № 12, с. 2361–2363.
- [3] Моргеништерн З.Л., Неуструев В.Б. – Оптика и спектроскопия, 1971, т. 30, в. 2, с. 361–364.
- [4] Lee K.H., Crawford J.H. – Phys. Rev. B, 1979, v. 19, N 6, p. 3217–3221.
- [5] Hughe R.C. – Phys. Rev. B, 1979, v. 19, N 10, p. 5318–5328.

Уральский политехнический
институт им. С.М. Кирова,
Свердловск

Поступило в Редакцию
27 апреля 1988 г.